



報道関係各位

2011年3月28日  
Qcept Technologies

## アジア大手半導体メーカーが、3Xnm メモリおよびロジック製品の生産に Qcept Technologies 社の NVD 検査ソリューションを採用

大量生産歩留管理戦略を支援する NVD 検査の重要性が認められ  
半導体メーカー世界大手 2 社からシステム受注

- 2011年3月21日米国ジョージア州アトランタ発 -

Qcept Technologies 社は、アジアに本社を置く世界大手半導体メーカー2社向けに、ChemetriQ<sup>®</sup> 5000 ノンビジュアル欠陥 (NVD) 検査システムを納入したことを発表しました。パターン付きおよびパターン無しの両方のウェーハについて NVD 検査を実施可能な ChemetriQ 5000 は、ツールおよびラインのモニタリング用など幅広い用途に使用でき、歩留習熟度を高めるとともに持続的な歩留向上を可能にします。

顧客の1社は、ChemetriQ 5000 システムを 3Xnm デザインルールメモリー・ウェーハおよび、ロジック製品ウェーハのモニタリング用に採用、もう1社は、3Xnm デザインルールメモリー・ウェーハのモニタリング用に ChemetriQ 5000 システムを採用しました。本システムは、顧客の生産ファブで洗浄後検査、反応性イオンエッチング工程モニタリング、湿式洗浄工程モニタリングを含む複数の用途に使用されます。

Qcept Technologies 社のブレット・バーグマン CEO は次のように述べています。「当社は前四半期に ChemetriQ 5000 システムの採用が急増したことを大変嬉しく思っています。大手半導体メーカーはデバイス歩留の最適化における NVD 検査の重要性の高まりを認識しつつあり、当社でも歩留管理戦略強化のサポートを依頼されるケースが増えてきました。このような顧客やその他の顧客が NVD の課題を解決し、歩留を高め、ファブの生産性を上げるためのサポートを喜んで提供していきたいと考えています」

3Xnm 以下のデザインノードでは、半導体デバイス性能の改善は従来のリソグラフィック・シュリンクのみならず、新材料や新しいデバイス構造によってもたらされています。これらの新材料や新構造に伴い、ウェーハ洗浄や表面処理には極めて精密な管理が必要となり、デバイス歩留を高める上での管理工程の重要性はますます高まっています。ウェーハ洗浄と表面処理はファブで最も繰り返されるステップであるため (ウェーハ1枚につき最高100回)、最適化されていない洗浄工程により、これらの先進的なデザインノードで大きな歩留損失が発生する可能性が高くあります。

ChemetriQ 5000プラットフォームを使用することで、有機物・無機物の残渣、金属汚染、プロセスに起因する電荷などを伴う最適化されていない洗浄によって発生し、大きな歩留損失をもたらし得る一方で光学式検査システムでは検出不可能なNVDの迅速な、ウェーハ全面を対象としたインライン検査が可能になります。この検査は、半導体ウェーハ表面における仕事関数の変化を検出する画期的な非破壊手法を採用することによって可能となっています。検査アルゴリズムとポジショニングの正確性の向上により、ChemetriQ 5000の性能はさらに高まり、パターン付きおよびパターン無しの両方のウェーハについての各種NVDの検出を実現しています。

#### <Qcept Technologies 社について>

Qcept Technologies 社は、最先端の半導体製造で用いられるノンビジュアル欠陥 ( NVD ) 用ウェーハ検査ソリューションを提供する企業です。Qcept の ChemetriQ<sup>®</sup>プラットフォームは、従来の光学検査機器では検出が不可能なサブモノレイヤーの有機・金属残渣やプロセスに起因する電荷、不要な表面不均一性などの NVD のインライン、非接触式、フルウェーハでの検出において、重要な各種プロセスへの普及が進みつつあります。

詳しい情報は[www.qceptech.com](http://www.qceptech.com)をご覧ください。

ChemetriQ は Qcept Technologies 社の登録商標です。その他の商標は各社に帰属します。

#### 【リリースに関するお問い合わせ先】

広報代理店： オグルヴィ PR

担当： 牧平、大北

Tel： 03-5793-2365 / 2384

Email： [kaori.makihira@ogilvy.com](mailto:kaori.makihira@ogilvy.com), [hiroko.okita@ogilvy.com](mailto:hiroko.okita@ogilvy.com)